

## บทที่ 5

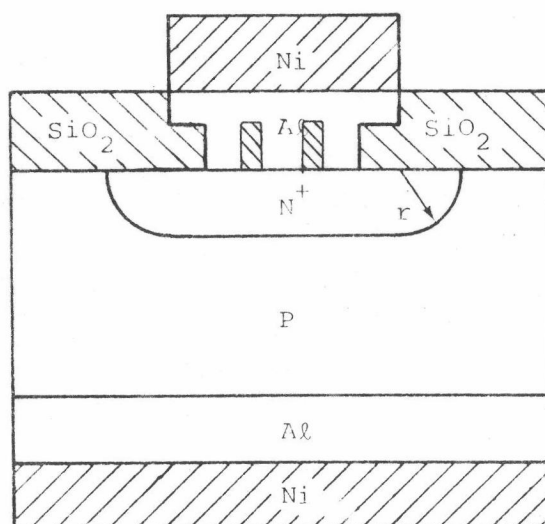
### การวัดและผลการทดลอง

การวัดและผลการทดลองของไดโอดที่ได้ทำการประดิษฐ์ขึ้นนี้จะแสดงผลทางด้านฟิสิกส์ และทางด้านไฟฟ้า ซึ่งผลทางด้านฟิสิกส์แสดงให้เห็นถึงวิธีการเลือกวัสดุที่จะนำมาประดิษฐ์ไดโอด และแนวทางในการสร้างไดโอด เพื่อให้ได้คุณสมบัติทางด้านไฟฟ้าที่ดีขึ้นตรงกับความต้องการ

ในการทดสอบคุณสมบัติทางด้านไฟฟ้านั้นได้นำเอาไดโอดที่มีขายในท้องตลาดมาทดสอบ เปรียบเทียบด้วย

#### 5.1 ขอบข่ายและคุณสมบัติที่ต้องการ

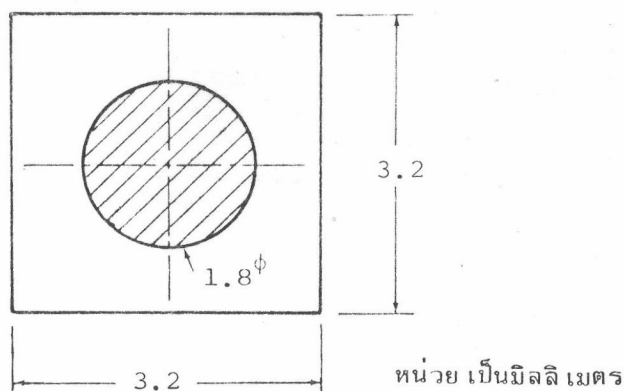
ในการประดิษฐ์ไดโอดโดยมีโครงสร้างที่สมบูรณ์ดังรูปที่ 5.1 จะเห็นว่าโลหะที่ใช้ทำขั้วต่อ (ohmic contact) คือ อลูมิเนียม แต่อลูมิเนียมนี้ไม่สามารถที่จะบัดกรีด้วยตะกั่วได้ง่าย ดังนั้นจึงนำนิกเกิล (Ni) มาฉาบอีกทีด้วยวิธีการของการชุบ (Ni - electroless) เพื่อให้สามารถ บัดกรีด้วยตะกั่วได้ง่ายขึ้น



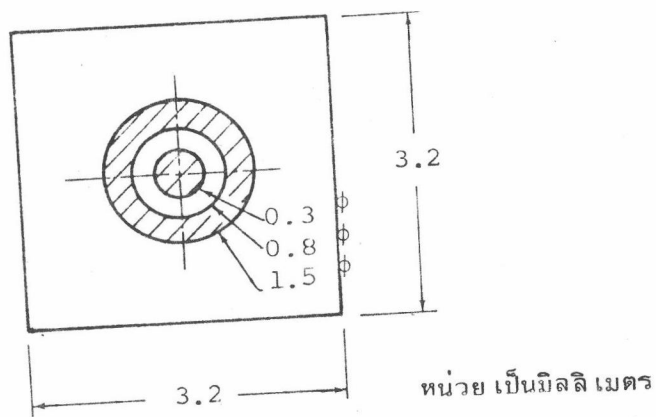
รูปที่ 5.1 โครงสร้างของไดโอดหัวต่อพี-เอ็น แบบชั้น

ในการทดลองประดิษฐ์ไดโอดนี้ ได้ใช้แวนผลึกซิลิกอนชนิดพีเป็นแวนผลึกที่มีความเข้มข้น  $1.8 \times 10^{15}$  อะตอม/ลูกบาศก์เซนติเมตร จากนั้นได้ทำการแพร่ซึมสารฟอสฟอรัสลงไปยังแวนผลึกโดยให้ความเข้มข้นสูง ( $10^{19}$  อะตอมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร เพื่อให้ได้หัวต่อแบบชั้น (one-side step junction) ซึ่งการแพร่ซึมสารฟอสฟอรัสนี้ได้ใช้วิธีการแพร่ซึมสารเจือปน และ drive-in เพื่อให้การแพร่ซึมของสารชนิดเอ็นซึมลงไปบนเนื้อแวนผลึกมากๆ (โดยปกติมากกว่า 25 ไมโครเมตร สำหรับไดโอดกำลัง) การแพร่ซึมสารเจือปนที่ลึกๆ จะได้ส่วนโค้งที่บริเวณปลายคานามาก เป็นเหตุให้สนามไฟฟ้าบริเวณส่วนโค้งจางลงซึ่งเท่ากับว่าการพังทะลุจะเกิดที่แรงดันพังทะลุสูงขึ้น จากการคำนวณโดยอาศัยความเข้มข้นของพาหะดังกล่าวและได้ทำการแพร่ซึมสารเจือปนลงไปได้ลึกประมาณ 3.52 ไมโครเมตร จะได้แรงดันพังทะลุที่จ่ายให้กับไดโอดอยู่ในช่วง 80-120 โวลท์ และกระแสอิ่มตัวย้อนกลับมีค่าประมาณ  $2.3 \times 10^{-12}$  แอมแปร์ ดังนั้นไดโอดที่ทำการประดิษฐ์ขึ้นจึงมีคุณลักษณะที่ต้องการต่างๆ ไปดังนี้

- 5.1.1 ด้านหน้าและด้านหลังฉาบด้วยอลูมิเนียม ด้วยวิธี Evaporation โดยให้ความหนาไม่น้อยกว่า 3000 อังสตรอม
- 5.1.2 ความลึกของชั้นแพร่ซึมอยู่ในช่วง  $3 \pm 1$  ไมโครเมตร
- 5.1.3 ความหนาของแวนผลึก  $230 \pm 20$  ไมโครเมตร
- 5.1.4 ส่วนโค้งของชั้นแพร่ซึมจะต้องเป็นแบบ cylindrical หรือแบบ spherical
- 5.1.5 ขนาดของหน้ากากเป็นไปดังรูปที่ 5.2 เพื่อให้ทนกระแสตามกำหนด (current rating) ได้ถึง 3 แอมแปร์



รูปที่ 5.2 แสดงขนาดของหน้ากากที่ใช้ในการเปิดช่อง  $\text{SiO}_2$  เพื่อเตรียมการแพร่ซึมสารฟอสฟอรัส ในขั้นตอน predeposition



รูปที่ 5.3 แสดงขนาดของหน้ากากที่ใช้เปิดช่อง  $\text{SiO}_2$   
เพื่อเตรียมการฉาบอลูมิเนียม

## 5.2 การทดสอบ

การทดสอบไดโอดที่ได้ประดิษฐ์ขึ้น ได้แบ่งการทดสอบเป็นสองส่วนใหญ่ๆ คือ การทดสอบทางด้านฟิสิกส์ และการทดสอบทางด้านไฟฟ้า

### 5.2.1 การทดสอบทางด้านฟิสิกส์

#### 5.2.1.1 การทดสอบความไม่สมบูรณ์ของแวนผลึกซิลิกอน

##### ก) เครื่องมือและอุปกรณ์

1. กล้องขยาย
2. ถ้วยตวงสารเคมี
3. ถ้วยผสมสารเคมี
4. ถาดวางแวนผลึกสำหรับจุ่มลงในสารเคมี

ข) สารละลาย (Dash Etch Solution)

1. HF (48 %) 1 ส่วน
2. CH<sub>3</sub>COOH 10 ส่วน
3. HNO<sub>3</sub> (70 %) 3 ส่วน

ค) ขั้นตอนทดสอบ

1. แวนผลึกซิลิกอนที่มีลักษณะ เหมือนกับแวนผลึกที่จะนำไป  
ประดิษฐ์ไดโอด

ง) วิธีการ

1. ทำความสะอาดผิวหน้าแวนผลึกโดยจะต้องไม่มีคราบไขมันติดอยู่
2. นำแวนผลึกใส่ถาด
3. จุ่มแวนผลึกลงในสารละลายประมาณ 15 นาที
4. นำแวนผลึกล้างให้สะอาดและเบาให้แห้ง
5. นำแวนผลึกไปนับจำนวนจุดบกพร่องบนผิวหน้าของแวนผลึก โดยดูจากกล้องขยายต่อหน่วยพื้นที่

จ) ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบ เมื่อมองด้วยกล้องไมโครสโคปจะเห็นแวนผลึกที่ใช้ประดิษฐ์ไดโอดที่มีจุดบกพร่องอยู่ประมาณ 10 จุดต่อ ซม.<sup>2</sup> ถ้าพื้นที่ของการใช้ทำหัวต่อพี-เอ็น มาก โอกาสที่จะพบจุดบกพร่องบริเวณรอยต่อพี-เอ็น จะมีมาก ทำให้ไดโอดที่ประดิษฐ์กันมีกระแสลัดตัวย้อนกลับ และแรงดันพังทะลุต่ำ

5.2.1.2 การทดสอบการทำ Mesa Patternก) เครื่องมือและอุปกรณ์

1. น้ำยาไวแสง 1 ชุด
2. ถ้วยตวงน้ำยาเคมี

3. ถ้วยผสมน้ำยาเคมี
4. Scanning Microscope JSM-T20 ของ JEOL  
(ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาฯ)
5. เครื่องกัดแว่นผลึกซิลิกอน

ข) สารละลาย

- |    |                      |        |    |           |
|----|----------------------|--------|----|-----------|
| 1. | HF                   | 50 %   | 70 | มิลลิลิตร |
| 2. | HNO <sub>3</sub>     | 70 %   | 10 | มิลลิลิตร |
| 3. | CH <sub>3</sub> COOH | 99.7 % | 30 | มิลลิลิตร |

ค) ขั้นตอนทดสอบ

1. แว่นผลึกซิลิกอนที่มีลักษณะเหมือนกับแว่นผลึกที่จะนำไปประดิษฐ์ไดโอด
2. ผิวของแว่นผลึกซิลิกอนถูกปกคลุมด้วยซิลิกอนไดออกไซด์หนา 5500 อังสตรอม

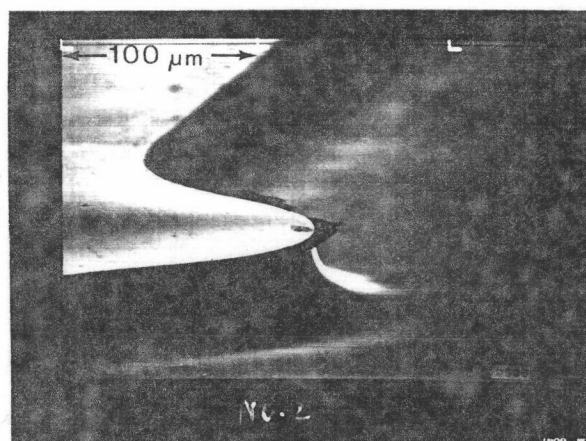
ง) วิธีการ

1. ให้นำกากาดังรูปที่ 5.2 ถ่ายแบบและทำการกัดซิลิกอนไดออกไซด์ออกจนได้แบบที่กำหนดเอาไว้
2. นำแว่นผลึกซิลิกอนจุ่มลงในสารละลายประมาณ 15 นาที
3. ทำการล้างแว่นผลึกให้สะอาดและเป่าให้แห้งด้วย N<sub>2</sub>
4. นำแว่นผลึกไปทำการกัดและตัดเพื่อการทดสอบ
5. นำแว่นผลึกไปดูด้วยกล้อง scanning microscope

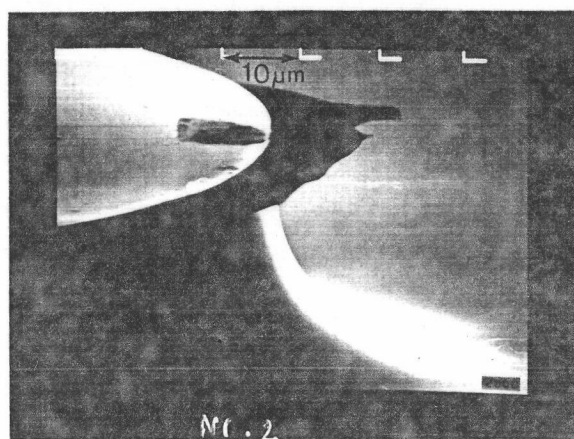
จ) ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบนี้แสดงให้เห็นว่าสารละลายที่ใช้สามารถกัดเนื้อซิลิกอนได้เร็วกว่าเนื้อของซิลิกอนไดออกไซด์ในอัตราส่วน 3-10 ไมโครเมตร/วินาที ต่อ 20 อังสตรอม/วินาที ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลการกัดทำ mesa pattern ได้ผลดีตามต้องการดังแสดงในรูปที่ 5.4 และรูปที่ 5.5 ดังนั้นจึง

อาจนำเอาสารละลายนี้ไปทำการกัดขอบของหัวต่อบริเวณที่เป็นส่วนโค้งออก เพื่อให้แรงดันไฟฟ้าย้อนกลับไปเกิดที่บริเวณตรงกลาง ซึ่งจะได้แรงดันพังทลายที่สูงขึ้น แต่จากการทดลอง เนื่องจากบริเวณหัวต่ออยู่ใกล้กับผิวมาก (ประมาณ 3 ไมโคร เมตร) ทั้งยังใช้แว่นผลึกแบบหยาบจึงทำให้บริเวณหัวต่อถูกกัดไม่เรียบสม่ำเสมอทำให้ซิลิกอนไดออกไซด์ที่ป้องกันบริเวณหัวต่อไม่สม่ำเสมอไปด้วย จึงทำให้ผลของกระแสอิมิต์ย้อนกลับมีค่าสูงขึ้นและแรงดันพังทลายมีค่าต่ำลง ซึ่งมีผลจากบริเวณนี้แทน



รูปที่ 5.4 ภาพถ่าย Si และ SiO<sub>2</sub> ที่ถูกสารเคมีกัดออกเพื่อทำ mesa pattern



รูปที่ 5.5 ภาพถ่าย Si และ SiO<sub>2</sub> (mesa pattern) ที่ถูกขยายขึ้นโดยใช้กล้องขยาย scanning microscope

### 5.2.1.3 การทดสอบความต้านทานของน้ำ DI

#### ก) เครื่องมือและอุปกรณ์

1. มัลติมิเตอร์
2. กระจกวัดความต้านทานน้ำรูปทรงกระบอก แผ่นโลหะ เป็นรูวงแหวน 2 วง วางห่างกัน 1 เซนติเมตร

#### ข) ขั้นตอนทดสอบ

1. น้ำ DI

#### ค) วิธีการ

1. นำน้ำ DI ใส่ในกระจกวัดความต้านทาน
2. นำมัลติมิเตอร์วัดความต้านทานของน้ำ
3. ความต้านทานที่ได้จะมีหน่วยเป็น โอห์ม-ซม.

#### ง) ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบพบว่า ความต้านทานจำเพาะของน้ำ DI ที่ใช้ในการประดิษฐ์ไดโอดอยู่ในช่วงระหว่าง 1-2 เมกกาโอห์ม-เซนติเมตร เพื่อที่จะทำไดโอดให้มีกระแสรั่วไหลน้อยที่สุด ดังนั้นน้ำ DI ที่ใช้จะมีค่าความต้านทานสูงกว่า 10 เมกกา-โอห์ม-เซนติเมตร ด้วยเหตุนี้ไดโอดที่ทำการประดิษฐ์ขึ้นจึงมีกระแสรั่วกลับมาก 1 มิลลิแอมแปร์ และทำให้ซิลิกอนไดออกไซด์ที่ปลูกขึ้นมีคุณภาพไม่ดีเท่ากับการใช้น้ำ DI ที่มีความต้านทานจำเพาะสูงกว่า 10 เมกกาโอห์ม-เซนติเมตร

### 5.2.2 การทดสอบทางด้านไฟฟ้า

#### 5.2.2.1 การทดสอบคุณสมบัติประจุที่บริเวณหลอดพาทะกับแรงดันย้อนกลับ

#### ก) เครื่องมือและอุปกรณ์

1. มัลติมิเตอร์
2. เครื่องวัดค่าประจุ (Boonton)

3. เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง
4. เครื่องกีดตัดแวนผลึก
5. หัวแรงและตะกั่วขั้วครี
6. Curve Tracer (Leader รุ่น LTC-905)

ข) ขั้นตอนสอบ

1. แวนผลึกที่ผ่านการแพร่ซึมโดยให้ได้ความลึกประมาณ 3.5 ไมโคร เมตร
2. ฉาบแวนผลึกด้วยอลูมิเนียมหนาประมาณ 5500 อังสตรอม
3. เลือกไดโอดกำลังด้วย curve tracer

ค) วิธีการ

1. ตัดแวนผลึกและตัดตามรอยที่ได้กำหนดไว้ จะได้ไดโอดเป็นตัวๆ
2. ใช้ curve tracer คัดเลือกไดโอดกำลังที่ได้ประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยให้มีกระแสอิ่มตัวย้อนกลับน้อยที่สุด
3. นำไดโอดที่ได้ไปติดด้วยการบัดกรีดังรูปที่ 5.6
4. วัดค่าประจุตัวถัง ทรานซิสเตอร์ เปล่าๆ ก่อน
5. นำไดโอดดังรูปที่ 5.6 ไปทำการวัดและทดสอบคุณสมบัติประจุที่บริเวณปลดพาหะกับแรงดันย้อนกลับ ดังตัวอย่างรูปที่ 5.7
6. บันทึกค่าประจุกับแรงดันย้อนกลับ

ง) วิธีการคำนวณ

1. การคำนวณหาค่าความหนาแน่นของพาหะ ( $N_B$ ) จากสมการที่ 2.23 หาค่าความจุที่บริเวณปลดพาหะในหน่วยพื้นที่

$$\frac{d(A/C_j)^2}{dV} = \frac{2}{q\epsilon_S N_B}$$



$$N_B = \frac{2}{q^E S} \cdot \frac{dV}{\frac{C_j}{A}^{-2}} \cdot (10^{-12} \cdot 100)^2$$

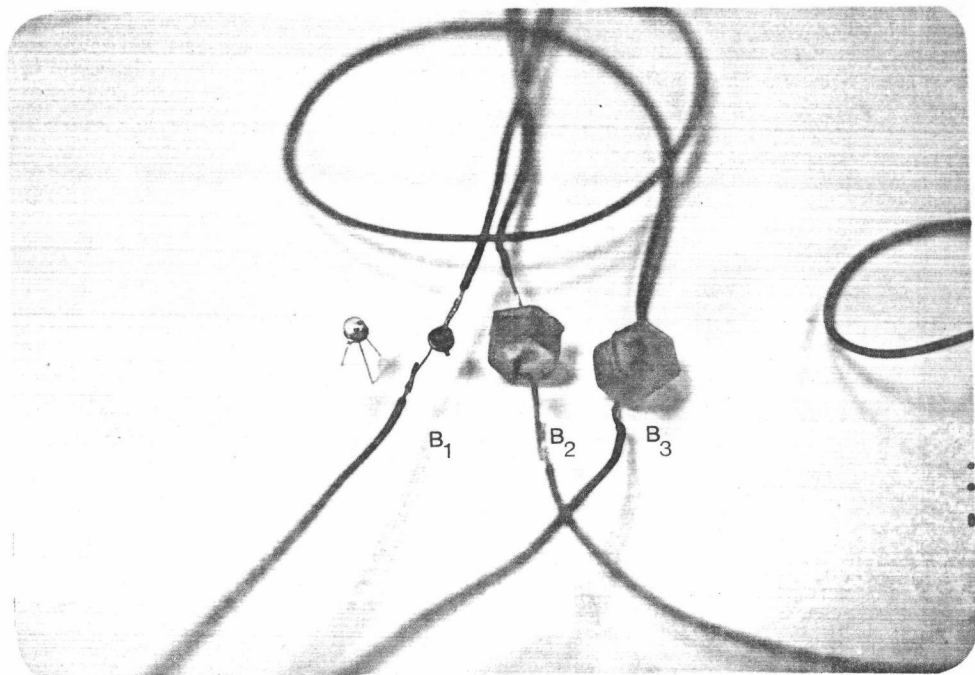
$$N_B = \frac{2(10^{-10})^2}{1.60219 \times 10^{-19} \times 11.8 \times 8.85 \times 10^{-14}} \cdot \frac{dV}{\frac{C_j}{A}^{-2}}$$

$$N_B = 1.195 \times 10^{11} \cdot \frac{dV}{\frac{C_j}{A}^{-2}}$$

ตัวอย่างจากตารางที่ 5.3 ค่าของ  $B_1$  ช่องระหว่าง 1 ถึง 1.5 โวลต์,  $dV = 0.5$  V,  $\frac{C_j}{A}^{-2} = 3.923 \times 10^{-5}$

$$N_B = 1.195 \times 10^{11} \times \frac{0.5}{3.923 \times 10^{-5}}$$

$$= 1.5 \times 10^{15} \text{ อะตอม / ลูกบาศก์ เซนติ เมตร \#}$$



รูปที่ 5.6 แสดงไดโอดที่เตรียมไว้สำหรับการวัดคุณสมบัติประจุที่บริเวณพลาสมา  
กับแรงดันย้อนกลับ



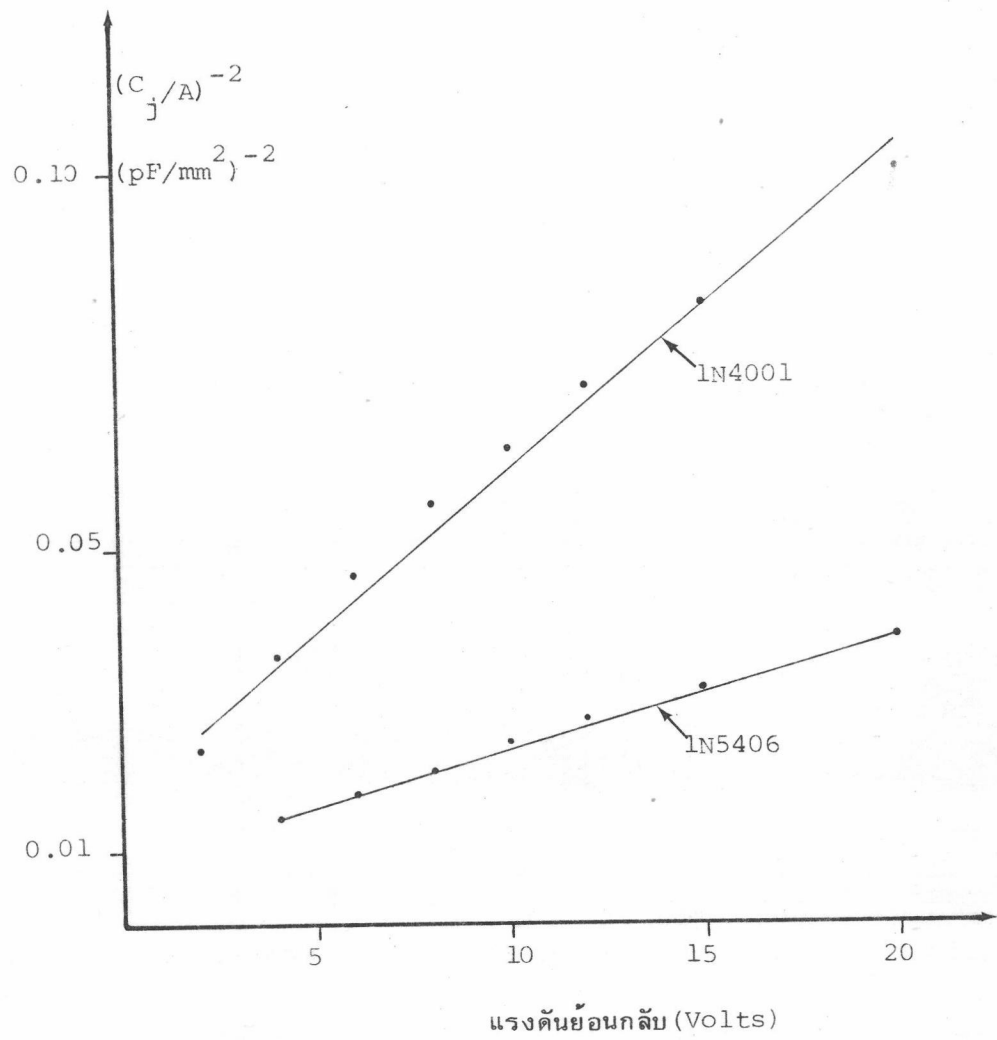
รูปที่ 5.7 แสดง เครื่องมือที่นำมาทดสอบคุณสมบัติประจุที่บริเวณหลอดพาหะกับแรงดันย้อนกลับ

จ) ผลการทดสอบ

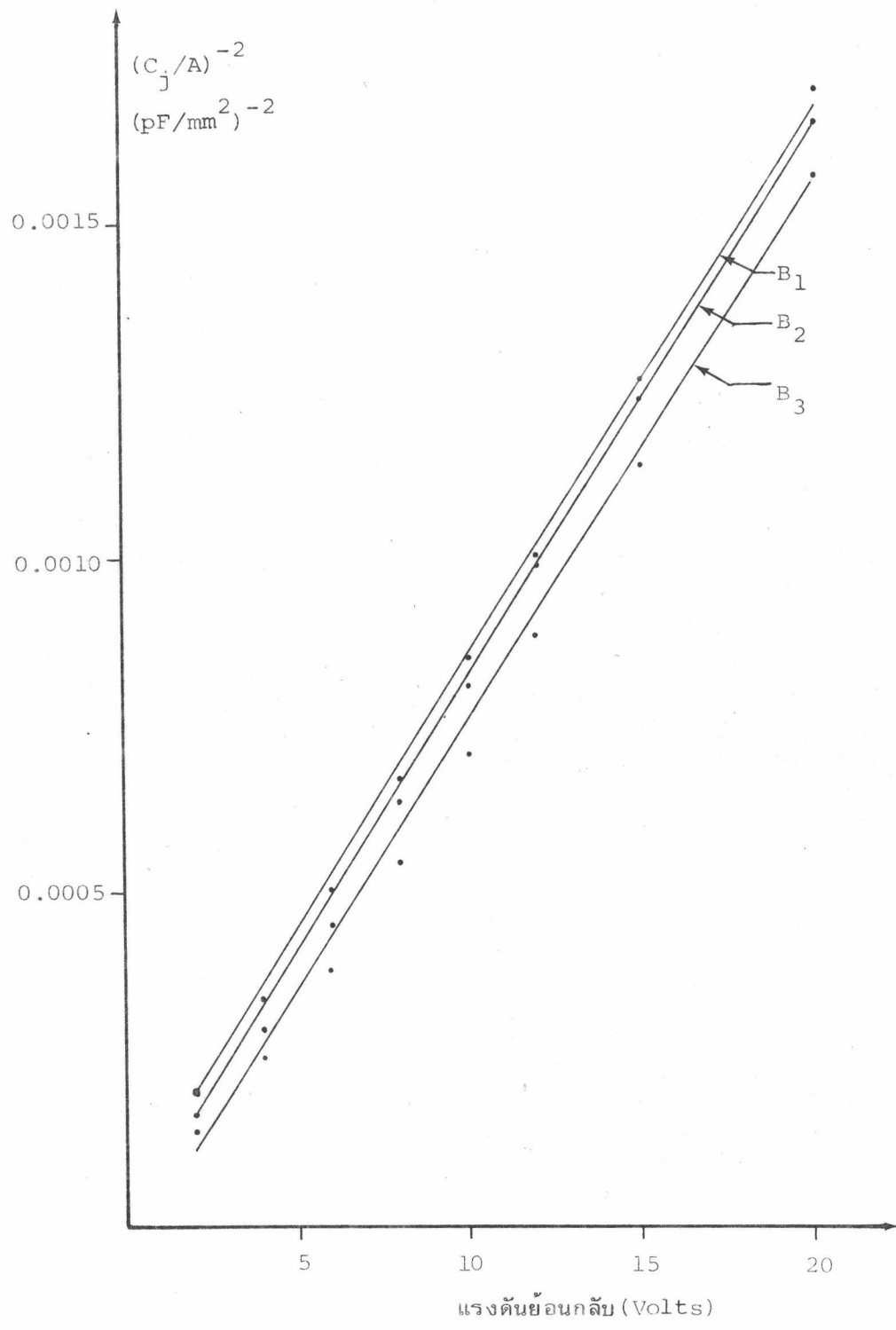
เนื่องจากไดโอดที่ได้เตรียมขึ้นได้ติดอยู่บนตัวถังของทรานซิสเตอร์ ดังนั้นจึงทดสอบค่าประจุของตัวถังทรานซิสเตอร์ได้เท่ากับ 0.77 พิโคฟารัด (stay capacitance) ที่แรงดัน - 15 โวลต์ จากนั้นจึงนำไดโอดที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นและไดโอดที่มีจำหน่ายในท้องตลาด (1N4001 และ 1N5406) นำมาวัดค่าประจุที่บริเวณหลอดพาหะกับแรงดันย้อนกลับ ซึ่งได้แสดงดังรูปที่ 5.8 ก) และรูปที่ 5.8 ข) โดยที่แกนนอนเป็นแกนของแรงดันย้อนกลับ ส่วนแกนตั้งเป็นแกนของพื้นที่หน้าตัดของไดโอด ต่อค่าประจุที่บริเวณหลอดพาหะยกกำลังสอง  $(c_j/A)^{-2}$

ในกราฟรูปที่ 5.8 ก) และรูปที่ 5.8 ข) สามารถหาค่าแรงดันที่ตกคร่อมไดโอด ( $V_{Bi}$ ) เมื่อค่าของ  $(c_j/A)^{-2}$





รูปที่ 5.8 ข. แสดงคุณสมบัติแรงดันย้อนกลับกับค่าประจุรี เวณปลอดพาหะ  
ของไดโอด 1N4001 และ 1N5406



รูปที่ 5.8 ก. แสดงคุณสมบัติแรงดันย้อนกลับกับค่าประจุรี เวจปลอดพาหะ ของไดโอด B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>, B<sub>3</sub>

ประมาณศูนย์ และผลของความชันของกราฟที่ได้จะสามารถหาค่าของความหนาแน่นของพาหะ ( $N_B$ ) ได้ในขนาด  $10^{13}$  ซม.<sup>-3</sup> สำหรับไดโอด 1N4001, 1N5046 และขนาด  $10^{15}$  ซม.<sup>-3</sup> ดังแสดงในตารางที่ 5.1 สำหรับไดโอดที่มีค่าความหนาแน่นของพาหะ  $10^{13}$  ซม.<sup>-3</sup> และ  $10^{15}$  ซม.<sup>-3</sup> นี้ เมื่อพิจารณาจากรูปที่ 2.9 สามารถนำมากำหนดค่าแรงดันพังทะลุของไดโอดได้ประมาณ 1000 โวลต์ และ 100 โวลต์ ตามลำดับ กรณีที่เป็นการพังทะลุแบบ เพลน

ตารางที่ 5.1 แสดงค่าเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณการแพร่ซึม (D) ความหนาแน่นของพาหะ ( $N_B$ ) และแรงดันที่ตกคร่อมหัวต่อ ( $V_{Bi}$ ) ของไดโอด

	1N4001	1N5046	B1	B2	B3	หน่วย
$V_{Bi}$	~0.6	~0.6	~0.6	~0.6	~0.6	V.
D	1.6	2.5	1.8	1.8	1.8	mm.
$N_B$	$\sim 2.6 \times 10^{13}$	$\sim 7.2 \times 10^{13}$	$\sim 10^{15}$	$\sim 10^{15}$	$\sim 10^{15}$	cm <sup>-3</sup>

#### 5.2.2.2 การทดสอบคุณสมบัติกระแสและแรงดัน

##### ก) เครื่องมือและอุปกรณ์

1. มัลติมิเตอร์
2. เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง
3. เตาไฟฟ้าที่ควบคุมอุณหภูมิได้
4. เครื่องวัดอุณหภูมิ

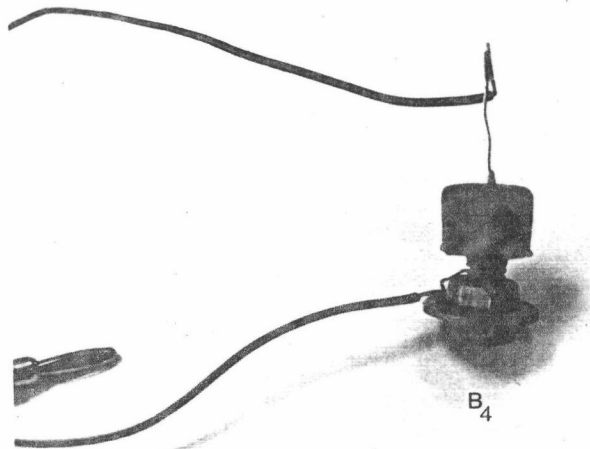
5. แผ่นระบายความร้อน (heat sink)
6. curve tracer (LEADER และ LTC-905)

ข) ขั้นตอนทดสอบ

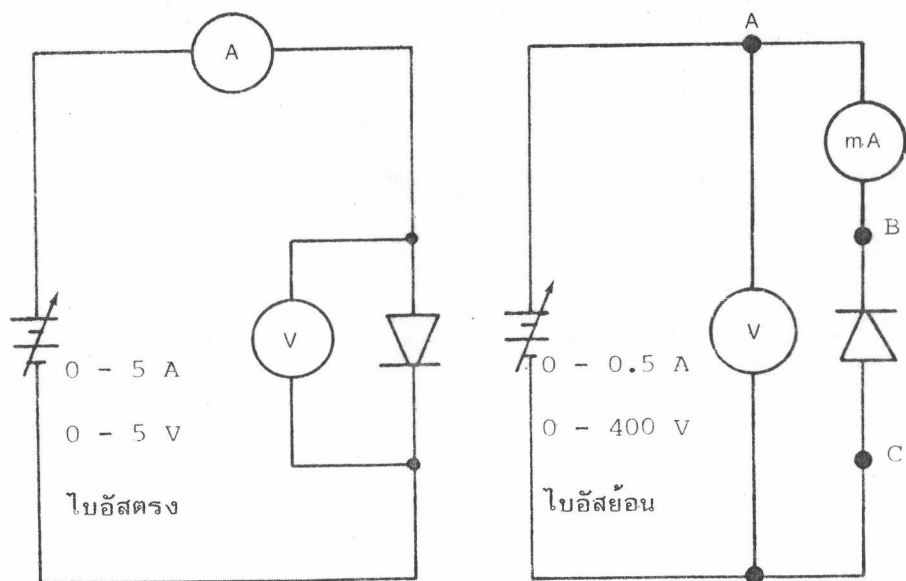
1. แวนผลึกที่ผ่านการแพร่ซึมความลึกประมาณ 3.5 ไมโครเมตร
2. ฉาบแวนผลึกด้วยอลูมิเนียมหนาประมาณ 5500 อังสตรอม
3. เลือกไดโอดกำลังด้วย curve tracer

ค) วิธีการ

1. ใช้ curve tracer คัดเลือกไดโอดที่ได้ประสิทธิภาพขึ้น โดยให้มีกระแสอิ่มตัวย้อนกลับน้อยที่สุด
2. นำไดโอดที่ได้ไปบัดกรี ดังรูปที่ 5.9
3. ทำการต่อวงจร ดังรูปที่ 5.10
4. ทำการวัดกระแสและแรงดันทั้งทางด้านไบอัสตรงและไบอัสย้อน ที่อุณหภูมิต่างๆ
5. ทำการบันทึกค่ากระแส แรงดันและอุณหภูมิ



รูปที่ 5.9 แสดงไดโอดที่เตรียมไว้เพื่อทดสอบคุณสมบัติกระแสและแรงดัน



$$V_{BC} = V_{AC} - V_{AB}$$

รูปที่ 5.10 วงจรที่ใช้วัดคุณสมบัติกระแสและแรงดัน

ง) วิธีคำนวณ1. การคำนวณหาแพคเตอร์ n จากผลการทดลอง

จากสมการที่ 2.33 หาค่าแพคเตอร์ n

$$n = \frac{q}{KT} (V_1 - V_2) / \ln \frac{J_1}{J_2}$$

$$n = \frac{38.7 (V_1 - V_2)}{\ln \left( \frac{J_1}{J_2} \right)}$$

ตัวอย่างจากกราฟรูปที่ 5.11 ค่าแรงดันตาม

ในช่วงระหว่าง 0.45-0.65 โวลต์

$$n = \frac{38.7 \times (0.45 - 0.65)}{\ln \left( \frac{74.3 \times 10^{-6}}{25 \times 10^{-3}} \right)} = 1.3 \#$$

2. การคำนวณหากระแสอิ่มตัวย้อนกลับ

จากสมการที่ 2.34 หาค่ากระแสอิ่มตัวย้อนกลับ

ต่อพื้นที่ 2.5 ตารางมิลลิเมตร

$$J_s = \frac{J}{\left( \exp \frac{qV}{nKT} \right) - 1}$$

โดยที่  $\frac{q}{nKT} = 29.1$  ที่อุณหภูมิ  $T = 300^\circ \text{K}$ 

ตัวอย่างจากกราฟรูปที่ 5.11 ค่าแรงดันตาม

ของ  $B_3$  เท่ากับ 0.65 โวลต์

$$\begin{aligned} J_s &= \frac{25 \times 10^{-3}}{\left( (\exp 29.1 \times 0.65) - 1 \right) \times 2.5 \times 10^{-2}} \\ &= 6 \times 10^{-9} \text{ แอมป์/ตารางเซนติเมตร} \end{aligned}$$



## จ) ผลการทดสอบ

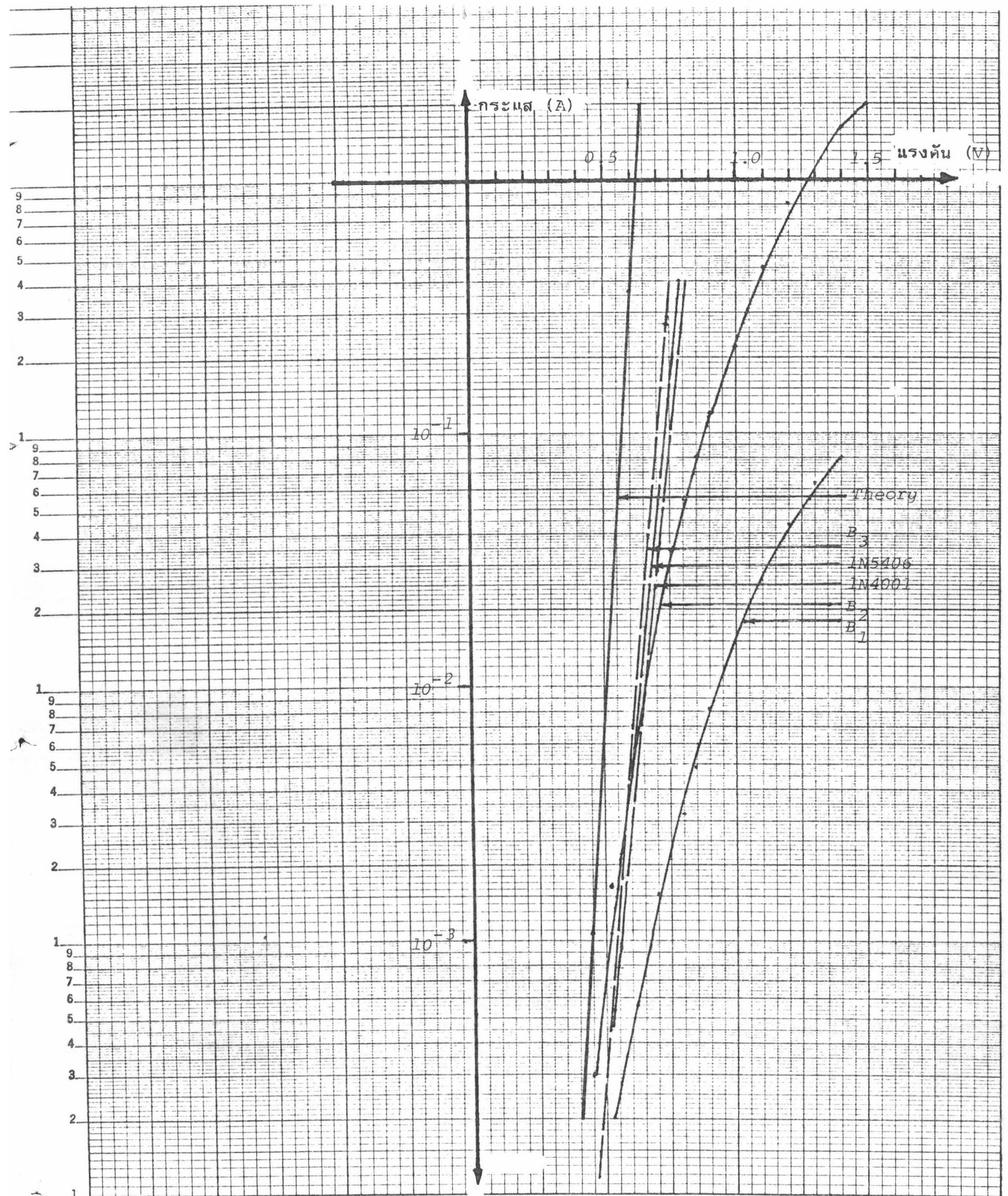
จากการทดสอบวัดกระแสตามและกระแสอิมตัวย้อนกลับ ดังรูปที่ 5.13 ค่าของแพคเตอร์  $n$  และกระแสอิมตัวย้อนกลับของไดโอดกำลัง ( $B_3$ ) มีค่าใกล้เคียงกับ ทฤษฎีของไดโอดที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ดังนั้นจากการชักตัวอย่างมาทำการคำนวณโดยใช้ค่าของ  $B_3$  ได้ค่าแพคเตอร์  $n$  ประมาณ 1.3 ได้ค่าของกระแสอิมตัวย้อนกลับประมาณ  $6 \times 10^{-9}$  แอมแปร์/ตารางเซนติ เมตร แต่จากการคำนวณค่าทางทฤษฎีโดยอาศัยค่าความเข้มข้นของแวนผลึก  $1.8 \times 10^{15}$  อะตอม/ลูกบาศก์เซนติ เมตรและแพคเตอร์  $n$  เท่ากับ 1 ได้ค่าของกระแสอิมตัวย้อนกลับประมาณ  $3 \times 10^{-11}$  แอมแปร์/ตารางเซนติ เมตร แสดงให้เห็นว่าค่าของ  $B_3$  มีค่าใกล้เคียงกับทฤษฎีมากและไดโอด  $B_3$  ยังมีค่าใกล้เคียงกับไดโอดที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ดังแสดงให้เห็นในกราฟรูปที่ 5.11 อย่างไรก็ตามกราฟของไดโอด  $B_1$  และ  $B_2$  ได้แตกออกจากเส้นทฤษฎีมาก ทั้งนี้เพราะไดโอดดังกล่าวมีความต้านทานอนุกรมสูงนั่นเอง ถ้าความต้านทานอนุกรมไม่สูง เส้นกราฟที่ได้ก็จะเสมือนกับเส้นของไดโอด  $B_3$  ดังนั้นไดโอดที่ทำการประดิษฐ์ขึ้นถ้าข้อต่อที่ใช้ทำดีมาก ๆ ความต้านทานอนุกรมก็จะต่ำลง ทำให้ได้ไดโอดที่มีคุณสมบัติกระแสและแรงดันใกล้เคียงกับทฤษฎีมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณากราฟรูปที่ 5.13 แล้วจะเห็นได้ว่าที่แรงดันย้อน -20 โวลต์ จะมีกระแสอิมตัวย้อนกลับวัดได้ประมาณ 0.9 มิลลิแอมแปร์/2.5 ตารางมิลลิเมตร หรือมีค่าเท่ากับ  $3.6 \times 10^{-2}$

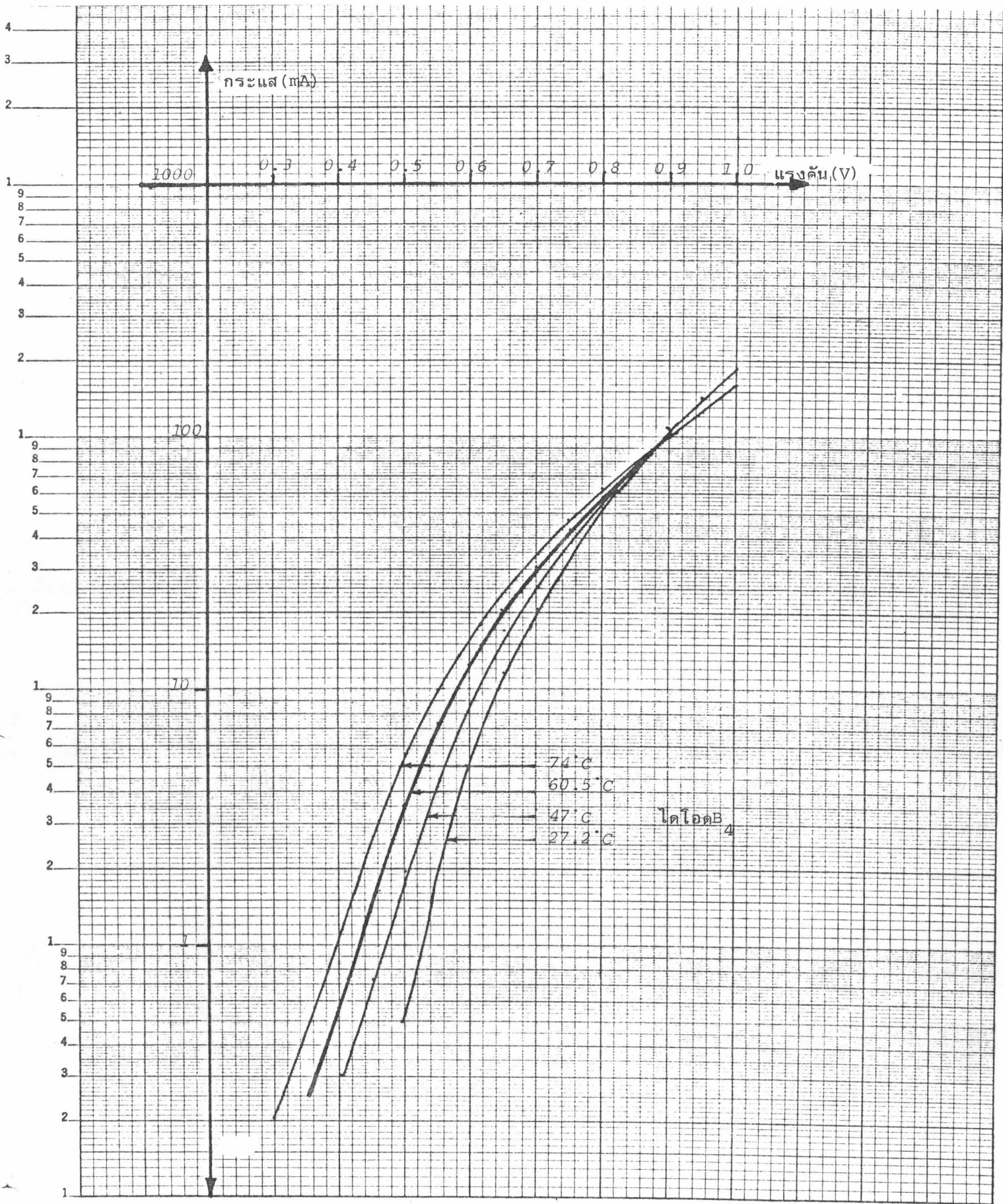
แอมแปร์/ตาราง เซนติ เมตร ซึ่งแตกต่างจากค่า  
 ที่ได้ในข้อ 2 หน้า 70 อยู่มาก ที่เป็นเช่นนั้น  
 เนื่องจากการประดิษฐ์ไดโอดนี้ได้ใช้แวนผลึกที่เป็น  
 แบบ Lap และขั้นตอนการถ่ายแบบและเปิดช่องซิลิ  
 กอนไดออกไซด์ไม่คมพอ จึงทำให้บริเวณขอบที่จะ  
 ทำการแพร่ซึม เกิดรอยขยักและจะเกิดกระแสรั่วตาม  
 ขอบและรอยขยักดังกล่าวมาก

แวนผลึกใดๆ ที่มีความไม่สมบูรณ์ในเนื้อแวนผลึกมาก  
 และทำขั้นตอน Drive-in นานๆ ความสามารถ  
 ของการแพร่ซึมจะต่างกันทำให้บริเวณหัวต่อ พี-เอ็น  
 ไม่เรียบซึ่งจะทำให้เกิดกระแสรั่วด้วยย้อนกลับ เพิ่มขึ้น  
 ได้อีกทางหนึ่ง

กราฟรูปที่ 5.12 และ 5.13 เป็นกราฟแสดงคุณสมบัติของกระแสและแรงดันแบบไบอัสตรงและไบอัสย้อน  
 โดยแสดงวิธีการทดลอง ดังรูปที่ 5.14 ซึ่งการทดลอง  
 นี้ได้นำเอาไดโอดที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นไปติดบนหัวน็อตเพื่อ  
 ทำให้อุณหภูมิของน็อตกับแวนผลึกของไดโอดมีค่าประ  
 มาณใกล้เคียงกัน ดังนั้นจึงอาจถือได้ว่าอุณหภูมิบริ  
 เวณหัวน็อตมีค่าประมาณใกล้เคียงกับแวนผลึกไดโอด  
 ที่ได้ทำการประดิษฐ์ขึ้น ซึ่งจากผลการทดลองแสดง  
 ให้เห็นว่า เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นกระแสตามและกระแสรั่ว  
 ด้วยย้อนกลับมีค่าสูงขึ้นตาม เป็นการแสดงให้เห็นว่า  
 ที่อุณหภูมิสูงจะมีคู่อิเล็กตรอนและโฮลมากทำให้กระแส  
 ตามและกระแสรั่วด้วยย้อนกลับสูงขึ้น



รูปที่ 5.11 กราฟแสดงคุณสมบัติกระแสและแรงดันของไดโอดที่อุณหภูมิ 27.2 องศาเซลเซียส



รูปที่ 5.12 กราฟแสดงคุณสมบัติกระแสและแรงดันของไดโอดในรูปที่ 5.9 ที่อุณหภูมิต่างๆ

แรงดัน (-V)

-20

-15

-12

-10

-5

0.5

1.0

กระแส (mA)

27.2°C

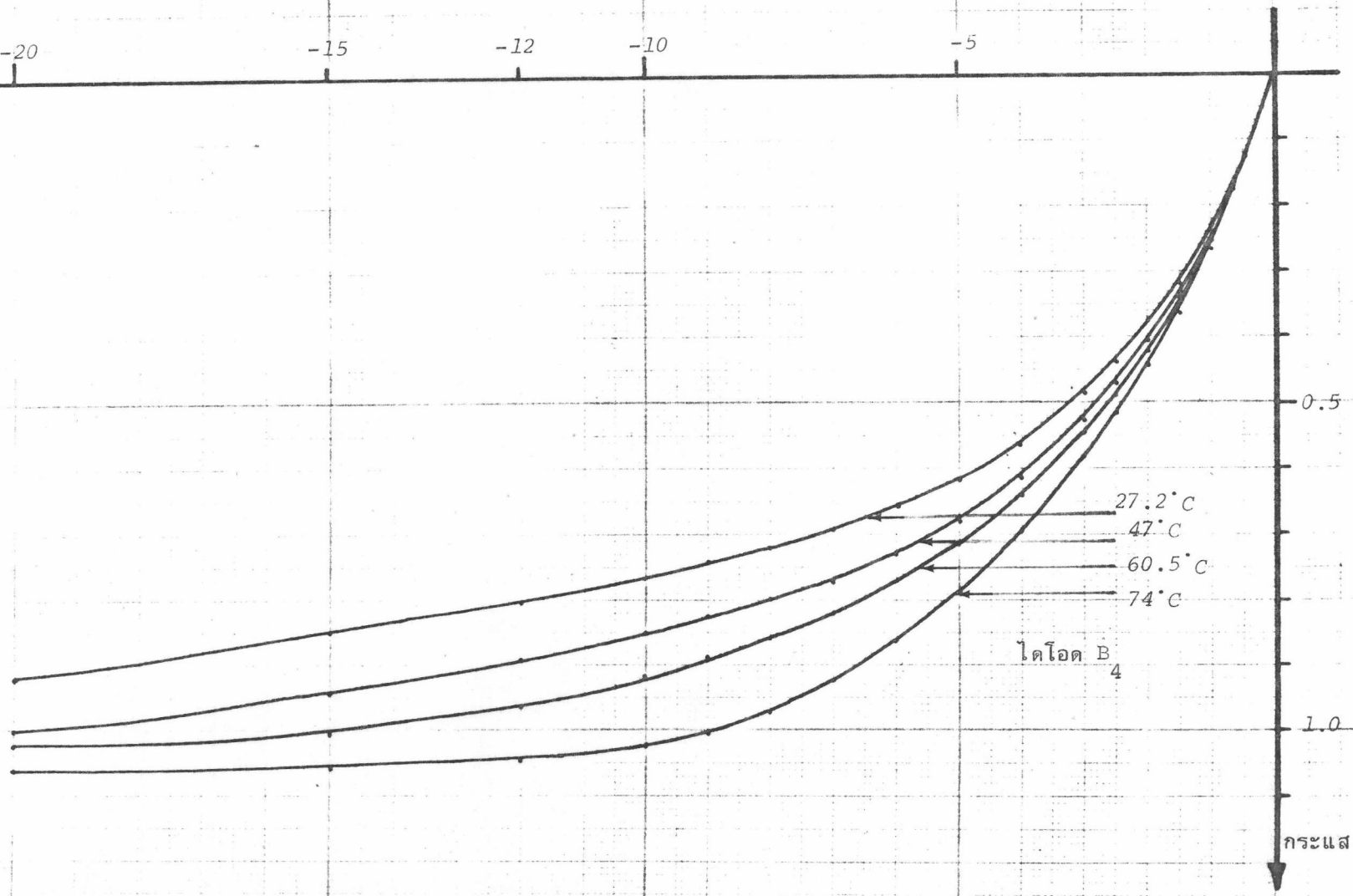
47°C

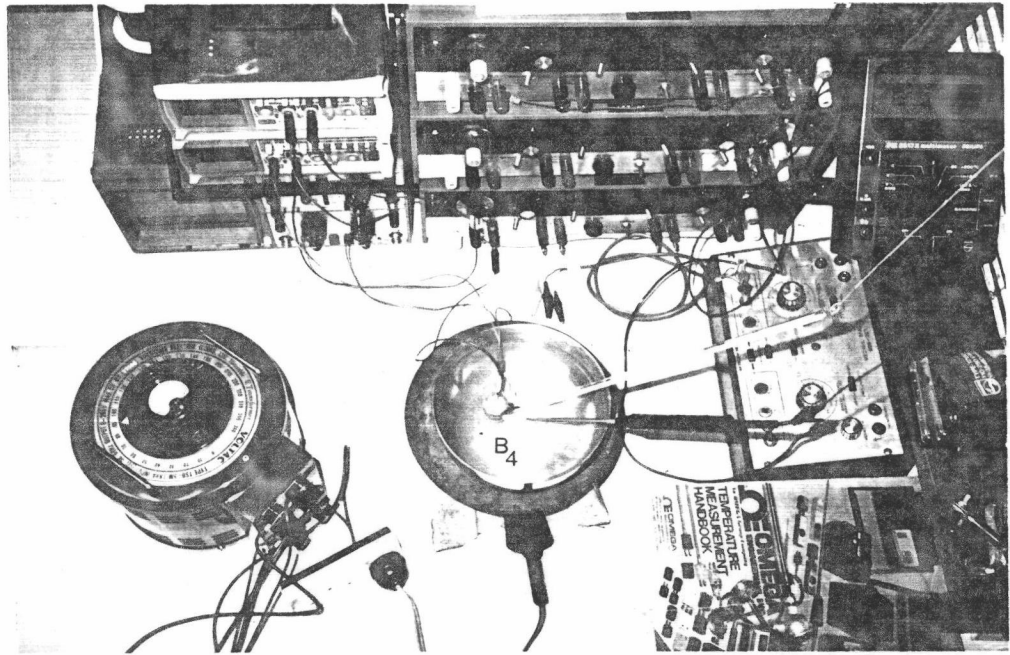
60.5°C

74°C

ไดโอด B<sub>4</sub>

รูปที่ 5.13 กราฟแสดงคุณสมบัติกระแสและแรงดันย้อนกลับของไดโอดในรูปที่ 5.9 ที่อุณหภูมิต่างๆ





รูปที่ 5.14 แสดงวิธีทดลองหาคณสมบัตินิกระแสะและแรงดันของไดโอดที่อุณหภูมิต่างๆ

### 5.2.2.3 การทดสอบหากระแสกำหนด (current rating)

#### ก) เครื่องมือและอุปกรณ์

1. มิลลิแอมป์เตอร์
2. แท่นยึดเพื่อการทดสอบ
3. thermo-couple
4. เครื่องวัดอุณหภูมิ
5. เต้าไฟฟ้าที่สามารถปรับอุณหภูมิได้
6. curve tracer
7. copper bar ขนาด 30x30x2 มิลลิเมตร

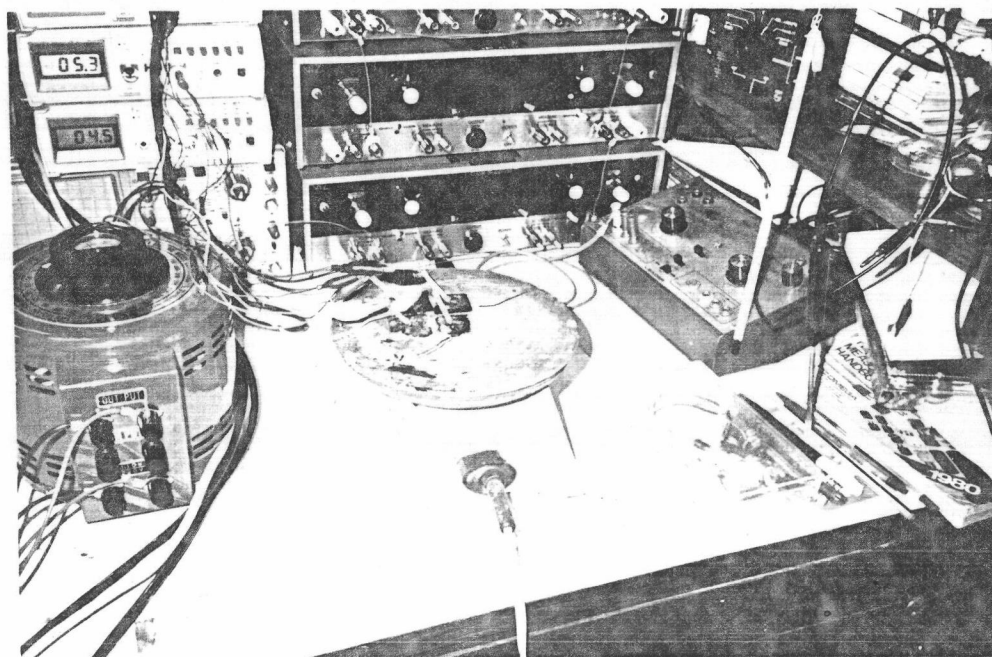
#### ข) ขั้นตอนทดสอบ

1. แวน์พลิกที่ได้ผ่านขบวนการแพร์ซิม การฉาบอลูมิเนียม และการชุบนิเกิลพร้อมที่จะนำมาบัดกรีเพื่อเตรียมการทดสอบ

2. ใช้ curve tracer คัดเลือกไดโอดที่ได้ประคิษฐ์ขึ้น  
โดยให้มีกระแสรั่วย้อนกลับน้อยที่สุด

ค) วิธีการ

1. ตัด copper bar ขนาด  $30 \times 30 \times 2$  มิลลิเมตร
2. เชาะรูรั้งที่ผิวตรงกลางแผ่น copper bar ลึกประมาณ 0.5 มิลลิเมตร
3. นำ thermo-couple ไปฝังและทำการบัดกรีด้วยเงิน
4. ทดสอบวัดแรงดัน thermo-couple ที่อุณหภูมิต่างๆ ดังรูปที่ 5.15
5. นำไดโอดไปติดตั้งบน copper bar ตรงบริเวณที่ thermo-couple ติดอยู่
6. นำไดโอดที่ได้จากข้อ 5 ไปยึดด้วยแท่นยึดเพื่อการทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 5.16 ก)
7. ต่อกสายไฟเพื่อการทดสอบดังวงจรรูปที่ 5.16 ข) และทำการบันทึกค่ากระแสรั่วและอุณหภูมิ



รูปที่ 5.15 แสดงการทำอุณหภูมิและแรงดันของ thermo-couple ที่ฝังลงในแผ่น copper bar

ง. การคำนวณหาอุณหภูมิที่หัวต่อ

ในรูปที่ 6.4 และรูปที่ 7.1 ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างทองแดงถึงหัวต่อ ( $\Delta T_{JCu}$ ) สามารถเขียนเป็นสมการได้ 3

$$T_{JCu} = R_{\theta JCu} \times P_{avg}$$

$$R_{\theta} = \frac{1}{K} \cdot \frac{L}{A}$$

เมื่อ  $P_{avg}$  = กำลังไฟ (W)

$R_{\theta}$  = ความต้านทานความร้อน ( $^{\circ}C/W$ )

$K$  = ความนำความร้อน ( $^{\circ}C-cm/W$ )

$L$  = ความยาว (cm)

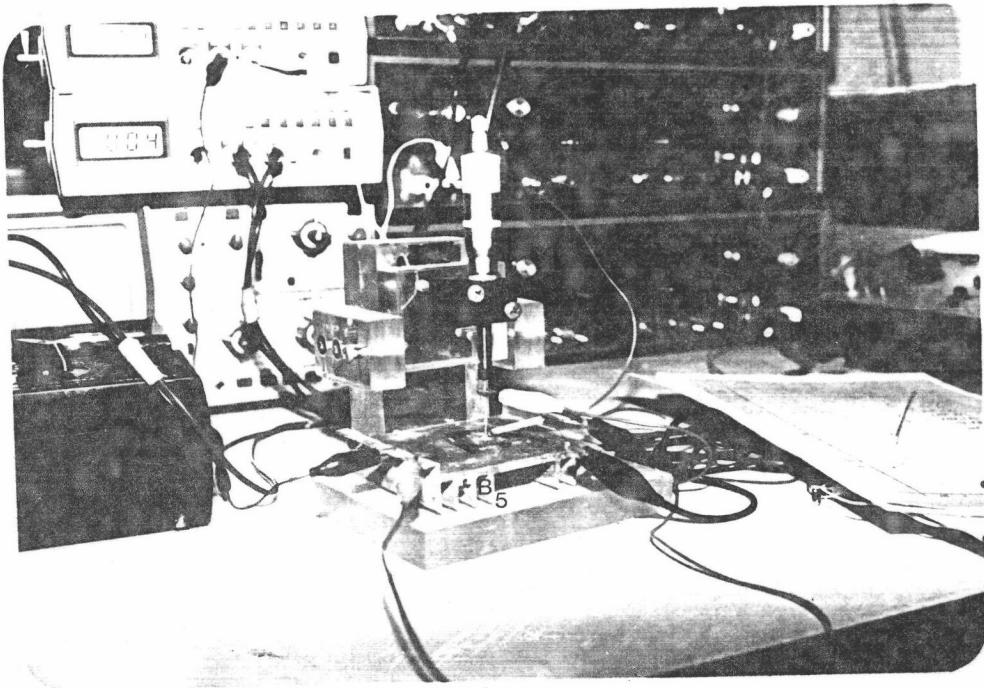
$A$  = พื้นที่ ( $cm^2$ )

จากการคำนวณโดยใช้ตารางที่ 6.1 รูปที่ 6.4 และรูปที่ 7.1 จะได้ค่า  $R_{JCu} = 1.7$  (องศาเซลเซียส/วัตต์)  $P_{avg} = 4.2$  วัตต์ ถ้าอุณหภูมิที่บริเวณทองแดง 100 องศาเซลเซียส จะได้อุณหภูมิที่หัวต่อประมาณเท่ากับ 107 องศาเซลเซียส

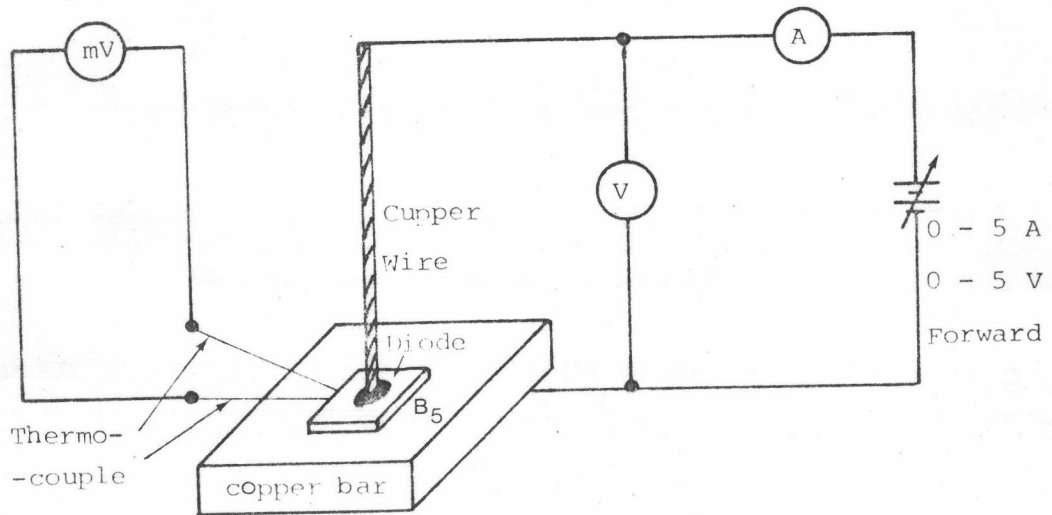


จ. ผลการทดสอบ

จากการทดลองได้นำเอา copper bar ที่ฝังด้วย thermo-couple ไปวางไว้บนเตาที่ปรับอุณหภูมิได้ ซึ่งผลการทดลองในรูปที่ 5.15 ถูกนำมาเขียนดังกราฟ รูปที่ 5.17 โดยประมาณเป็นเส้นตรงจากค่าอุณหภูมิตั้งแต่ 100 องศาเซลเซียส ถึง 200 องศาเซลเซียส และที่ค่าอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส จะให้แรงดันเท่ากับ 2.4 มิลลิโวลต์ จากการวัดไดโอดกำลังสามารถนำกระแสตรง ได้ 3 แอมแปร์ที่อุณหภูมิตริเวณแผ่นทองแดง เท่ากับ 100 องศาเซลเซียส (ทั้งนี้ได้ใช้ copper bar ขนาด 30x 30x2 มิลลิเมตรทำหน้าที่เป็นสพานไฟและเป็นตัวระบาย ความร้อนให้แก่ไดโอดกำลังที่ประดิษฐ์ขึ้นในเวลาเดียวกัน) หรือคำนวณเป็นอุณหภูมิตริเวณหัวต่อประมาณเท่ากับ 107 องศาเซลเซียส โดยมีแรงดันตามเท่ากับ 1.4 โวลต์



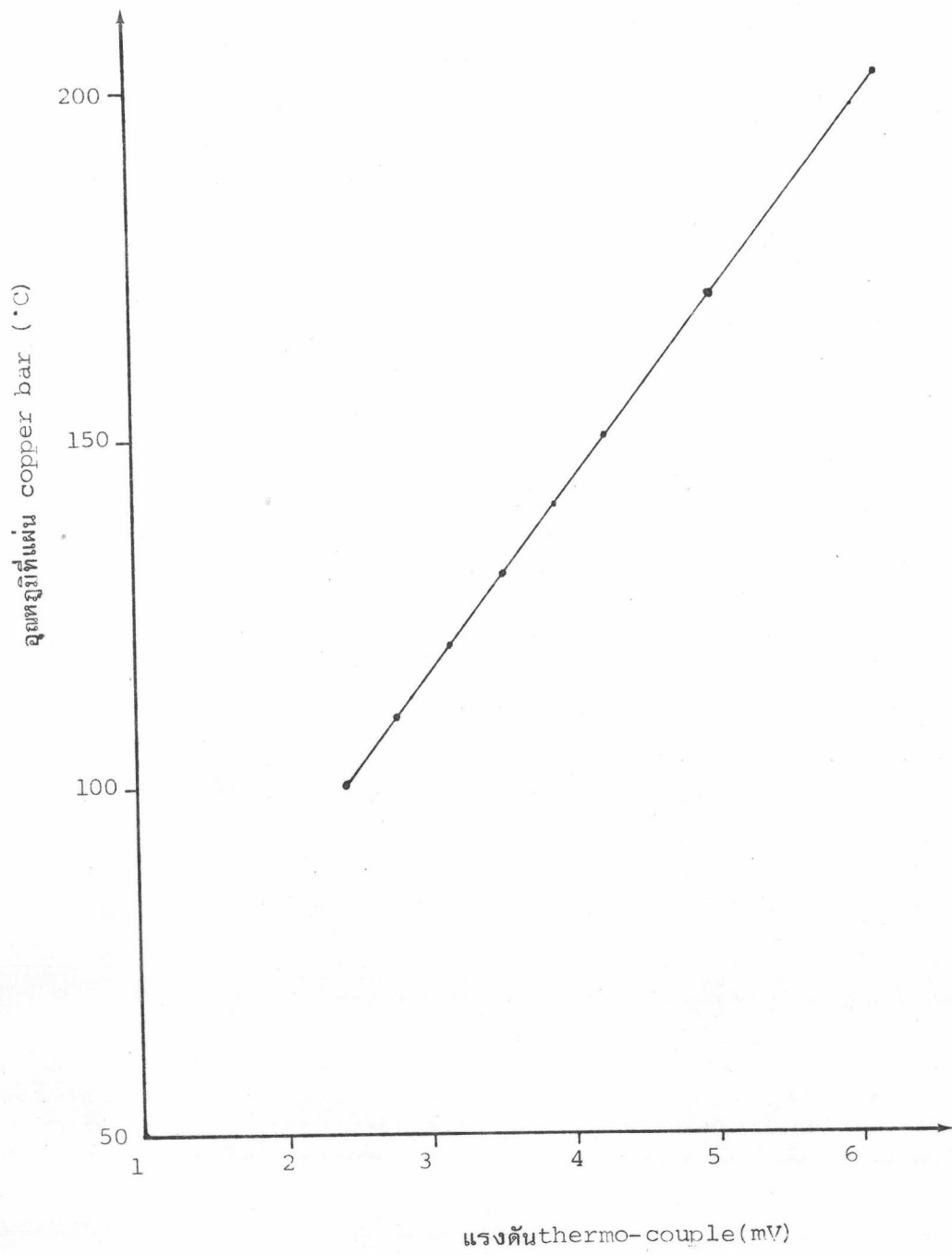
ก)



ข)

รูปที่ 5.16 ก) ภาพถ่ายแสดงการวัดหาค่ากระแสจำกัด (current rating)

ข) แสดงการต่อวงจรเพื่อการวัดค่าหาค่ากระแสจำกัด (current rating)



รูปที่ 5.17 กราฟแสดงอุณหภูมิและแรงดันที่ได้จาก thermo-couple ที่ฝังในแผ่น copper bar

#### 5.2.2.4 การทดสอบหาเวลาการฟื้นตัวย้อนกลับ

##### ก) เครื่องมือและอุปกรณ์

1. เครื่องกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นสี่เหลี่ยม (square wave)
2. ออสซิลโลสโคป (oscilloscope)
3. ความต้านทาน 100 โอห์ม

##### ข) ขั้นตอนทดสอบ

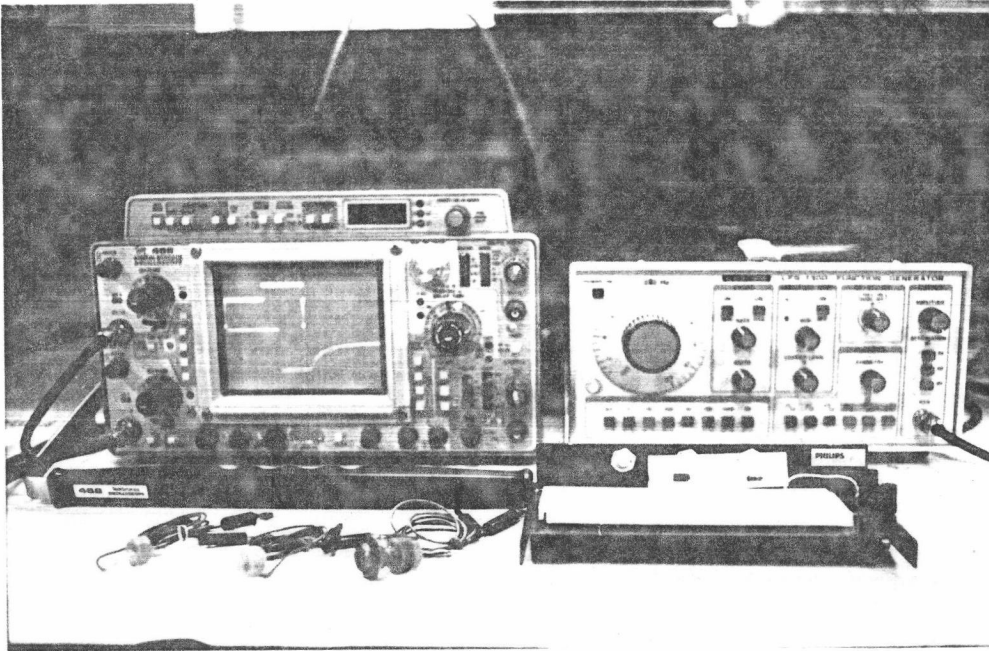
1. ไดโอด 1N4001, 1N5406,  $B_4$

##### ค) วิธีการ

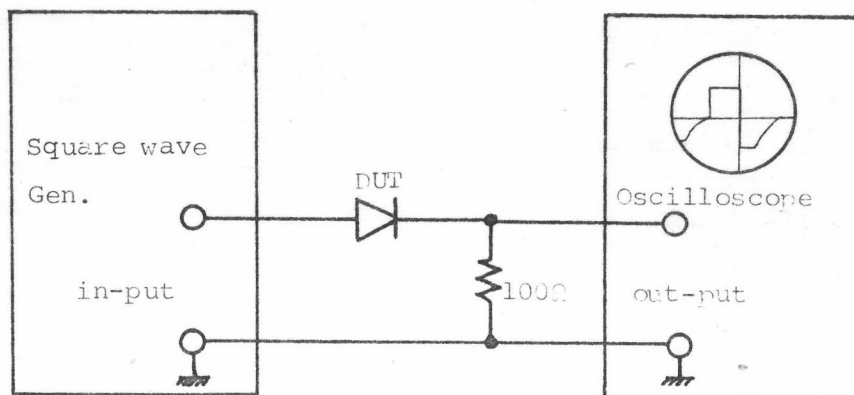
1. นำไดโอดกำลังมาต่อวงจรและทดสอบดังรูปที่ 5.18 และ 5.19
2. อ่านค่าเวลา  $t_1, t_2$  และ  $t_{rr}$  จากออสซิลโลสโคป

##### ง) ผลการทดสอบ

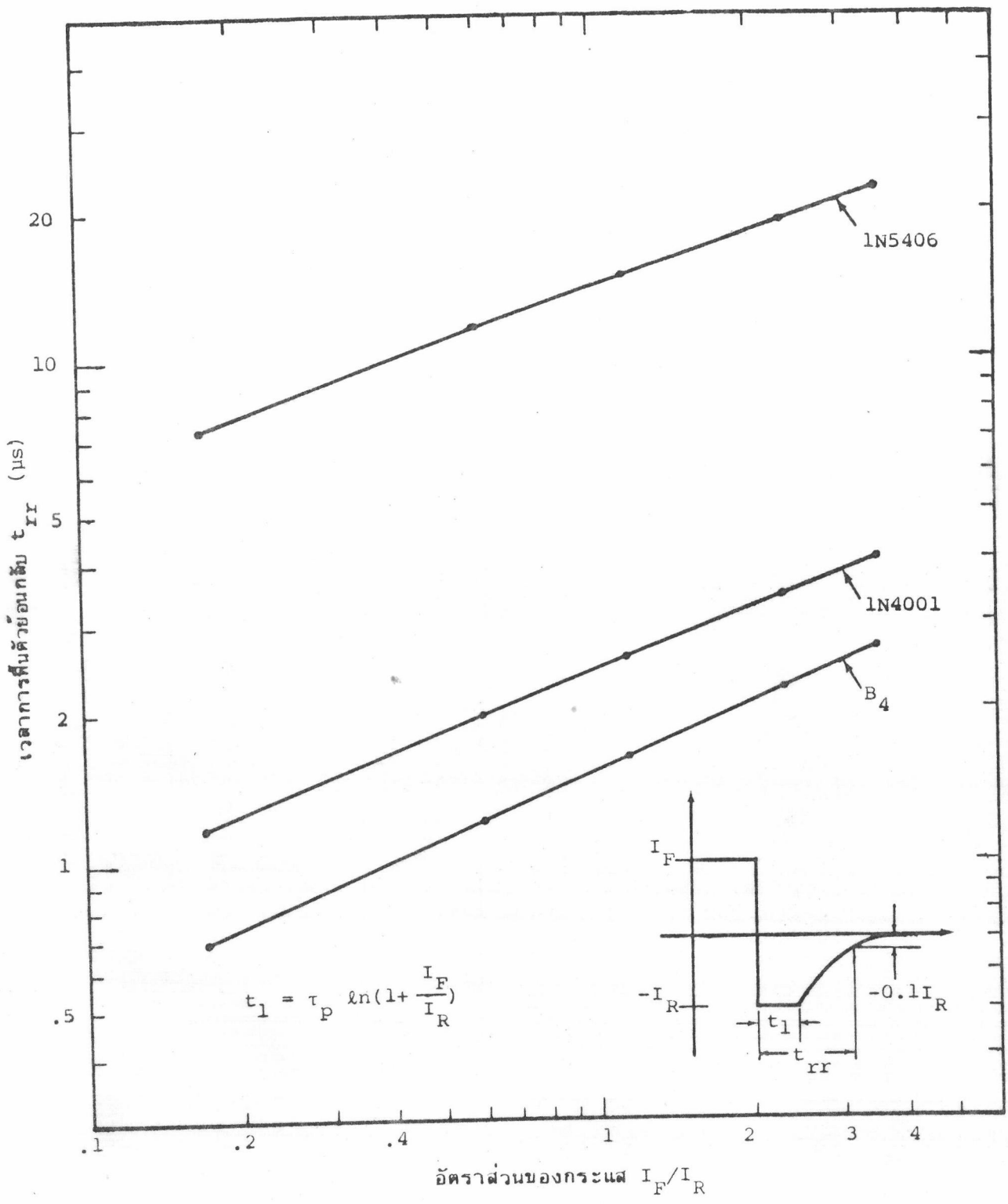
ผลการทดสอบ เมื่อวัดค่าแรงดันไบอัสตรงและไบอัสย้อนที่ตกร้อมความต้านทาน 100 โอห์ม มีค่าเท่ากับ 7.8 และ 5 โวลต์ ตามลำดับ วัดค่าเวลาของ  $t_1$  ของไดโอด 1N4001, 1N5406, และ  $B_4$  มีค่าเท่ากับ 4.7, 9.7 และ 1.4 ไมโครวินาที ตามลำดับ ซึ่งผลการทดสอบนี้เมื่อนำค่าไปแทนลงในสมการที่ 2.49 สามารถคำนวณหาเวลาชีวิตพาหะ ( $T_p$ ) ได้เท่ากับ 5, 10.3, 1.5 ไมโครวินาที ตามลำดับ ตามรูปที่ 5.20 จะเห็นได้ว่าไดโอดกำลังที่ได้ประดิษฐ์ขึ้น ( $B_4$ ) ให้ค่าเวลาการฟื้นตัวย้อนกลับ ( $t_{rr}$ ) ต่ำกว่าไดโอด 1N4001 และ 1N5406 ทำให้ไดโอดกำลังที่ประดิษฐ์ขึ้น ( $B_4$ ) สามารถทำงานได้มีความถี่สูงกว่า



รูปที่ 5.18 แสดงรูปการทดสอบหาเวลาการฟื้นตัวของอินกัลบ



รูปที่ 5.19 แสดงวงจรที่ใช้ทดสอบหาเวลาการฟื้นตัวของอินกัลบ



รูปที่ 5.20 กราฟแสดงการฟื้นตัวย้อนกลับของไดโอด 1N4001, 1N5406 และ B4

ที่อุณหภูมิ 27.2 องศาเซลเซียส

## 5.3 สรุป

ในการทดสอบไดโอดที่ประดิษฐ์ขึ้นได้แบ่งการทดสอบออกเป็นสองทาง คือ การทดสอบคุณสมบัติของไดโอดทางด้านฟิสิกส์ และการทดสอบคุณสมบัติของไดโอดทางด้านไฟฟ้า ผลในการทดสอบทางด้านฟิสิกส์พบว่า ความไม่สมบูรณ์ของแวนฟลักมีส่วนทำให้กระแสอิ่มตัวย้อนกลับ และแรงดันพังทะลุต่ำลง ซึ่งได้ใช้สารละลายลาย (dash etch solution) ทดสอบพบจุดบกพร่องอยู่ประมาณ 10 จุดต่อซม<sup>2</sup> ในการประดิษฐ์ไดโอดได้ใช้พื้นที่ 2.5 ตารางมิลลิเมตรดังรูปที่ 5.2 ซึ่งโอกาสที่พบจุดบกพร่องประมาณ 0.25 หรือในการประดิษฐ์ไดโอดโดยใช้พื้นที่ดังกล่าว 100 ตัว จะได้ไดโอดที่ใช้ได้ประมาณ 75 ตัว และเสียประมาณ 25 ตัว การทดสอบทำ mesa pattern สามารถกัดซิลิกอนได้ลึกประมาณ 40 ไมโครเมตร โดยใช้เวลาในการกัด (etching) 15 วินาที และแวนฟลักที่มีผิวเป็นเงามันจะได้ความคมของขอบที่ถูกกัดออกดีกว่าแวนฟลักที่มีผิวหยาบ ในการใช้น้ำ DI ที่มีค่าความต้านทานต่ำเพื่อทำความสะอาดแวนฟลักก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ไดโอดที่ประดิษฐ์ขึ้นมีกระแสอิ่มตัวย้อนกลับสูงและคุณภาพของซิลิกอนไดออกไซด์ที่ปลูกขึ้นไม่ดี

ผลในการทดสอบคุณสมบัติทางด้านไฟฟ้า ได้ทำการทดสอบเปรียบเทียบกับไดโอด 1N4001 และ 1N5406 ดังแสดงในตารางที่ 5.2

ตารางที่ 5.2 แสดงค่าเปรียบเทียบระหว่างไดโอดที่ประดิษฐ์ขึ้นกับ 1N4001 และ 1N5406

ข้อมูล	1N4001	1N5406	ไดโอด B <sub>4</sub>	หน่วย
แรงดัน ( $V_{Bi}$ )	~0.6	~0.6	~0.6	V
เส้นผ่าศูนย์กลาง	1.6	2.5	1.8	mm
ความเข้มข้นพาหะ ( $N_B$ )	$\sim 10^{13}$	$\sim 10^{13}$	$\sim 10^{15}$	cm <sup>-3</sup>
แฟกเตอร์ n	~1.5	~1.7	~1.4	-
กระแสอิ่มตัวย้อนกลับ	$\sim 4.3 \times 10^{-10}$	$\sim 3.7 \times 10^{-9}$	$\sim 6 \times 10^{-9}$	A/cm <sup>2</sup>
เวลาการฟื้นตัวย้อนกลับ ( $t_{rr}$ ) ( $I_F = 78$ mA, $I_R = 50$ mA)	$1.9 \times 10^{-6}$	$10.2 \times 10^{-6}$	$1.3 \times 10^{-6}$	s

นอกจากนี้กระแสจำกัด (current rating) ของไดโอดที่ประดิษฐ์ขึ้น (ณ พื้นที่ 2.5 ตารางมิลลิเมตร) มีขนาดถึง 3 แอมแปร์ ที่อุณหภูมิหัวต่อ 107 องศาเซลเซียส และหัวต่อแบบโอห์มมิกสามารถทนแรงดึงได้ถึง 78 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร